

レーザー蒸着装置



パルスレーザーを真空チャンバー内に導入してターゲット試料を薄膜化する蒸着器。エキシマレーザー、フェムト秒レーザーと組み合わせて、高融点試料等の薄膜作製が容易にできる。

1. 機器名称 レーザー蒸着装置
2. 機器分類
3. 担当部署 理工学部 ナノ物質工学科（國本研究室）
4. 装置担当者 國本 崇
5. 導入年度 2005 年
6. 型式 自作装置
7. 仕様・性能 基板面積：20×20 まで可能
 - ・ ガス導入可（酸素、水素（<3%）、不活性ガス）
 - ・ 基板温度：～600℃
8. 機器の開放状況（該当する区分を選択して下さい。）
 - ・ 研究指導条件下で、有料で開放している。
 - ・ 共同利用の場合のみ可
9. 利用上の注意点
10. 主な使用事例：蛍光体薄膜作製。